CLIPPEDIMAGE= JP404314374A

PAT-NO: JP404314374A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04314374 A

TITLE: NARROW BAND LASER DEVICE

PUBN-DATE: November 5, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME WAKABAYASHI, OSAMU KOWAKA, MASAHIKO KOBAYASHI, YUKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

KOMATSU LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP03108454

APPL-DATE: April 12, 1991

INT-CL (IPC): H01S003/136;H01S003/1055

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce fluctuation of beam profile and to acquire laser light of stable output by providing an air flow generating means which makes gas flow to a reflection surface of a diffraction grating.

CONSTITUTION: Air flow is made to occur in a reflection surface of a diffraction grating 30 by blowing gas against the diffraction grating 30 by a fan 40. Thereby, a surface of the diffraction grating 30 is cooled and gas in an area near a surface of the diffraction grating 30 is forcibly moved to prevent gas in an area near a surface of the diffraction grating 30 from being heated by the diffraction grating 30. Since air flow is generated forcibly in a surface of the diffraction grating 30, gas is not heated by heat of the diffraction grating 30 and does not generate natural convection. Thereby, it is possible to prevent beam profile from fluctuating.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

DWPI

DERWENT-ACC-NO: 1992-419435

DERWENT-WEEK: 199251

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Narrow band region laser device including fan near

diffraction grating

- generates stable laser light output minimising beam profile

fluctuation

through prevention of natural convection and by blowing gas to

reflector

NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: KOMATSU KK[KOMS]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0108454 (April 12, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 04314374 A November 5, 1992 N/A 006

H01S 003/136

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP04314374A N/A 1991JP-0108454

April 12, 1991

INT-CL_(IPC): H01S003/1055; H01S003/136

ABSTRACTED-PUB-NO: JP04314374A

EQUIVALENT-ABSTRACTS: CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/11

DERWENT-CLASS: V08

EPI-CODES: V08-A01A2; V08-A03A1; V08-A04B;

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-314374

(43)公開日 平成4年(1992)11月5日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FI ·

技術表示箇所

H01S 3/136

7630 - 4M

3/1055

7630-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平3-108454

(22)出願日

平成3年(1991)4月12日

(71)出願人 000001236

株式会社小松製作所

東京都港区赤坂二丁目3番6号

(72)発明者 若林 理

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製

作所研究所内

(72)発明者 小若 雅彦

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製

作所研究所内

(72)発明者 小林 諭樹夫

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製

作所研究所内

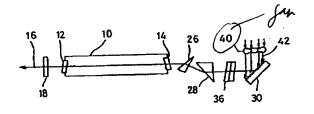
(74)代理人 弁理士 橋爪 良彦

(54) 【発明の名称】 狭帯域レーザ装置

(57)【要約】

【目的】ビームプロフィルの揺らぎを小さくし、安定した出力のレーザ光を得る。

【構成】波長選択素子として回折格子30の近くにファン40を配置し、回折格子30の反射面に気体42を吹きつけ、回折格子30の表面に気流を発生させ、回折格子近傍の気体温度の上昇、自然対流の発生を防止する。



10:レーザチャンバ

16:レーザ先

2628: プリズム

36: エタロン

30: 回析格子 40: ファン

42: 氢 体

15

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 波長選択素子として回折格子を有する狭 帯域レーザ装置において、前記回折格子の反射面に気体 を流す気流発生手段を設けたことを特徴とする狭帯域レ 一ザ装置。

前記気流発生手段は、送風機であること 【諸求項2】 を特徴とする請求項1に記載の狭帯域レーザ装置。

前記気流発生手段は、装置内に供給する 【請求項3】 パージガスのガス源と、このガス源に接続され、前記回 折格子の近傍に配置したガス吐出口とからなることを特 10 徴とする請求項1に記載の狭帯域レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スペクトル幅の狭いレ ーザ光を出力するレーザ装置に係り、特に縮小投影略光 装置用の光源として好適な狭帯域レーザ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体集積回路の高密度化に伴い、パタ ーンの微細化が著しく、微細なパターンを形成するため に、スペクトル幅の狭い、いわゆる狭帯域レーザ光を出 力するレーザ光源が求められている。そして、現在、エ ネルギー変換効率が高く、大出力が得られるところか ら、縮小投影露光装置用の光源としてエキシマレーザ装 置が注目されている。しかし、エキシマレーザ装置は、 スペクトル幅が広く、発振した光をそのまま縮小投影露 光装置の光源として使用することができない。そこで、 発振されたレーザ光を、エタロンや回折格子等の波長選 択素子 (狭帯域化素子) を使用してスペクトル幅を狭く することが行われている。

【0003】図7は、従来の狭帯域レーザ装置の一例を 30 示したものである。 本レーザ装置は、KFF等のレーザ 媒質が封入してあるレーザチャンパ10の両端部に窓1 2、14が設けてあり、レーザチャンパ10内で発生し たレーザ光16をレーザチャンパ10の外部に出射でき るようにしてある。そして、出力側となる窓12の前方 には、共振器を構成しているフロントミラー18が設け てある。

[0004] また、他方の窓14の後方(図の右側)に は、波長選択素子としてのエタロン20、22が配置し てあり、エタロン22の後方に共振器を構成しているり 40 アミラー24が設けてある。

【0005】このように構成した図7の狭帯域レーザ装 置は、一対のエタロン20、22によってレーザ光16 の狭帯域化を図っているため、放電幅を制限する必要が なく、狭帯域化の効率が高い利点がある。しかし、エタ ロン20、22には、レーザチャンパ10から出射され レーザ光16が直接入射するため、入射光のエネルギー 密度が高く、エタロン20、22がレーザ光16によっ て加熱され、波長選択特性の熱的安定性が著しく悪く、 しかもエタロン20、22の寿命が短くなる。また、2 50 光の強度の経時変化を測定したところ、図11に示した

つのエタロン20、22の選択波長を一致させる複雑な 波長制御が必要で、波長および出力の制御速度が遅くな

2

[0006] そこで、熱的に安定な回折格子を用い、図 8に示したように、窓14の後方にプリズム26、28 と回折格子30とをリトロー配置するとともに、窓1 2、14に隣接してアパーチャ32、34を配設した装 置がある。この狭帯域レーザ装置は、回折格子30が熱 的に安定であって、しかも波長の制御には、回折格子3 0の角度だけを調節すればよいため、波長制御および出 力制御が非常に速く行える。

【0007】また、図9に示したように、リトロー配置 したプリズム28と回折格子30との間にエタロン36 を配置した装置もある。この装置は、プリズム26、2 8とエタロン36とによって波長スペクトル幅を狭くす ることができるため、図8の装置のようにアパーチャ3 2、34を必要としない。そして、図9の装置は、レー ザ光16がプリズム26、28によって分散(拡大)さ れ、その後エタロン36と回折格子30とに入射するよ うになっているため、エタロン36と回折格子30とに 入射するレーザ光のエネルギー密度が小さく、また波長 のシフト量が少なくて、波長制御はエタロン36のみを 制御すればよいため、波長および出力の制御を速く行う ことができる。

【0008】さらに、波長選択素子にエタロンと回折格 子とを用いた狭帯域レーザ装置として、回折格子を斜入 射配置とするとともに、エタロンと回折格子とを気密室 内に配置し、その気密室の圧力を介してエタロンのギャ ップを制御し、選択波長の変動の吸収を図るものもある (特開昭64-84766号公報)。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上配の回折格 子30を用いた狭帯域レーザ装置は、回折格子30が入 射するレーザ光16のために加熱されて高温となり、こ の熱によって回折格子30の反射面(表面)近傍の気体 が温められて揺らぎ、レーザ光16のピームプロフィル が揺らぐ。

[0010] すなわち、発明者等は、図9の共振器内に エタロンと回折格子とを配置した装置のピームプロフィ ルを、一次元のフォトダイオードアレイセンサにレーザ 光16を入射させて測定したところ、図10に示したよ うな結果を得た。図から明らかなように、ピームの中心 からの各点における光強度が異なっていて、ピームプロ フィルが波を打ったような状態となっている。しかも、 ピームプロフィルの波は、回折格子30の表面近傍の気 体の揺らぎの影響により、時間の経過とともに同図 (A) ~ (C) のように移動することが観測された。

【0011】そこで、その波の周期を測定するために、 レーザ光16の中央部(0.025×0.5mm³)の 3

ような結果が得られ、変動の周期が約1秒であった。このピームプロフィルの揺らぎは、狭帯域レーザ装置を縮小投影露光装置の光源とした場合に、微細なパターンの結像に影響を与えるため、大きな問題となっている。

【0012】本発明は、前記従来技術の欠点を解消する ためになされたもので、ピームプロフィルの揺らぎを小 さくし、安定した出力のレーザ光を得ることができる狭 帯域レーザ装置を提供することを目的としている。

[0013]

【課題を解決するための手段】発明者等は、上配のビー 10 ムプロフィルのゆらぎの原因を究明するために種々の実験を行った。そして、各光学素子に気体を吹きつけたところ、プリズムとエタロンに気体を吹きつけても、ビームプロフィルの揺らぎに変化は見られなかったが、回折格子の表面に気体を吹きつけると、ビームプロフィルの揺らぎが小さくなった。

【0014】これは、回折格子の表面がレーザ光を吸収して熱を発生し、表面近傍の気体の温度が上昇して気体の屈折率が変化するため、回折格子による選択被長が気体の温度の高いところだけ変化し、エタロンの選択被長と一致しなくなって、ピームプロフィルが被を打つ現象が現れると考えられる。そして、回折格子に発生した熱により、回折格子近傍の気体に自然対流が起こり、ピームプロフィルが揺らぐものと考えられる。

【0015】本発明は、上記の知見に基づいてなされた もので、波長選択素子として回折格子を有する狭帯域レ ーザ装置において、前記回折格子の反射面に気体を流す 気流発生手段を設けたことを特徴としている。

[0016] 気流発生手段は、送風機であってもよいし、装置内に供給するパージガスのガス源と、このガス 30 源に接続され、回折格子の近傍に配置したガス吐出口とから構成してもよい。

[0017]

【作用】上記の如く構成した本発明は、気流発生手段によって回折格子の反射面(表面)に、強制的に気体の流れを生じさせる。これにより、回折格子が冷却されるとともに、回折格子の表面付近の気体を強制的に移動させ、回折格子近傍の気体の温度上昇を防止する。従って、回折格子の反射面近傍の気体の熱分布の発生と自然対流による影響とが除去され、ピームプロフィルの揺られる。

[0018]

【実施例】本発明に係る狭帯域レーザ装置の好ましい実施例を、添付面に従って詳説する。なお、前配従来技術において説明した部分に対応する部分については、同一の符号を付し、その説明を省略する。図1は、本発明の実施例に係る狭帯域レーザ装置の説明図である。

【0019】図1において、狭帯域レーザ装置は、プリ ズム26、28とエタロン36と回折格子30とがリト 50

ロー配置とされており、回折格子30の近くに気流発生手段として、送風機であるファン40が配置してある。ファン40は、回折格子30の微細な溝が形成してある反射面に、斜め上方から装置内の気体(例えば窒素)42を吹きつけ、回折格子30の表面に気流を生じさせる。

[0020] このように、ファン40によって回折格子30に気体を吹きつけて、回折格子30の反射面に気流を生じさせることにより、回折格子30の表面を冷却するとともに、回折格子30の表面付近の気体を強制的に移動させ、回折格子30の表面近傍の気体が回折格子30によって加熱されるのを防止する。従って、実施例は、回折格子30の表面付近の気体の温度が部分的に上昇し、その部分の屈折率が変化し、回折格子30の選択被長が変化してビームプロフィルが波を打ったような状態になることを避けることができる。

【0021】また、回折格子30の表面に強制的な気流を生じさせているため、気体が回折格子30の熱によって温められて自然対流を生ずることがなく、ビームブロフィルがゆらぐのを防止することができる。特に、回折格子30の表面付近での気流の風速が2m/s以上にすると、図2に示したように、ビームの揺らぎを非常に小さくすることができ、出力の安定したレーザ光16が得られる。

【0022】図3は、他の実施例を示したもので、気流発生手段としてのシロッコファン44が回折格子30の 溝のピッチ方向の一側に配置してあり、回折格子30の 反射面と平行に気体42を吹き出すようになっている。 本実施例においても、前配実施例と同様の効果が得られる。

【0023】図4、図5は、さらに他の実施例を示した もので、それぞれ気流発生手段としてクロスフローファ ン46と軸流ファン48を用い、回折格子30の溝に沿 って気体42を吹きつけるようにしたものである。

【0024】図6は、窒素ガスなどのパージガスを利用して回折格子の表面に気流を発生させるようにしたものである。すなわち、図6において、窒素ガス源である窒素ガスボンベ50は、気流発生手段を構成しており、パルプ52が設けてあって、このパルブ52に流量計54を有する管56が接続してある。そして、管56の先端吐出口58は、回折格子30の反射面の近くに配置され、回折格子30に形成した溝のピッチ方向に沿って、回折格子30の面とほぼ平行に窒素ガス60を吹き出すようになっている。

【0025】本実施例においても、前配各実施例と同様の効果が得られる。なお、窒素ガス60は、回折格子30の構に沿って吹き出すようにしてもよし、回折格子30の反射面と斜交するように吹き出させてもよい。

【0026】前記実施例においては、被長選択素子としてプリズム26、28とエタロン30と回折格子30と

(4)

を用いた狭帯域レーザ装置について説明したが、被長選択素子がプリズムと回折格子とからなる狭帯域レーザ装置であってもよい。また、前記実施例においては、回折格子30をリトロー配置した装置について説明したが、回折格子30はグレース型にしたものであってもよい。そして、前記実施例においては、エキシマレーザ装置について説明したが、He-Neレーザ等の他のガスレー

ザや色素レーザ等の他のレーザ装置であってもよい。

5

[0027]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれ 10 ば、回折格子の反射面に気体を吹きつけ、気流を生じさせるようにしたことにより、回折格子が冷却されるとともに、回折格子の表面近傍の気体が加熱されるのを防止でき、レーザ光の出力とビームプロフィルの安定とを図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る実施例の説明図である。

【図2】実施例の光強度の時間の経過に対する変化を示す図である。

【図3】気流発生手段としてシロッコファンを回折格子 20 の溝のピッチ方向の一端に配置した実施例の一部斜視図である。

【図4】気流発生手段としてクロスフローファンを用い

た実施例の一部斜視図である。

【図 5】 気流発生手段として軸流ファンを用いた実施例 の一部斜視図である。

6

【図6】パージガスによって気流を発生させる実施例の 説明図である。

【図7】波長選択素子がエタロンである従来の狭帯域レ ーザ装置の説明図である。

【図8】波長選択素子としてプリズムとエタロンとを用いた従来の狭帯域レーザ装置の説明図である。

【図9】波長選択素子としてプリズムとエタロンと回折 格子を用いた従来の狭帯域レーザ装置の説明図である。

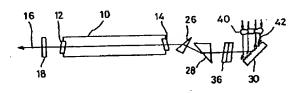
【図10】従来の狭帯域レーザ装置のビームプロフィルの時間変動の説明図である。

【図11】従来の狭帯域レーザ装置のビーム中心における光強度の時間変動の説明図である。

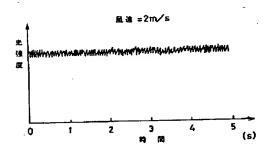
【符号の説明】

1 0	レーザチャンパ
16 .	レーザ光
26,28	プリズム
3 6	エタロン
3 0	回折格子
4 0	気流発生手段(ファン)
4.2	与从

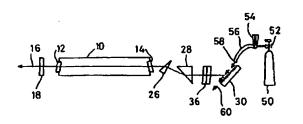
【図1】



10:レーザチャンパ 16:レーザ先 2628:プリズム 36: エタロン 30: 配新格子 40: ファン 【図2】



[図6]



[図7]

